

東京エレクトロンのコア技術は半導体およびFPD製造のためのプロセス技術およびメカトロニクス技術です。当社はこれらの技術に集中して製品競争力強化のための技術開発を推進していますが、知的財産権による保護なくしては、独自で開発した技術および製品も自社のものと主張することができません。我々は知的財産戦略が技術戦略および製品戦略と三位一体となることによって初めて、期待した効果を最大限に発揮することができると考えています。よって、これを重要な戦略の一つとして位置づけ、他社の優秀な技術も有効活用し、自社製品の市場への早期投入のために、ライセンスインをより重視する知的財産活動を行っています。

#### ライセンス関連活動の事業への貢献

当社は自社開発製品や開発技術について出願・権利化に成功した知的財産権を競合他社にライセンスアウトすることによって収益を上げるのではなく、製品や技術の差別化や競争優位性を確保するために有効活用しています。

技術がますます高度化、複雑化している半導体およびFPD製造装置分野においては、最先端技術を導入した新製品を効率良く開発し早期に市場投入する必要があり、当社は、自社保有であるか他社保有であるかにかかわらず、利用可能な知的財産権を有効に利用しています。

#### 知的財産の取得・管理、営業秘密管理、技術流出防止に関する方針

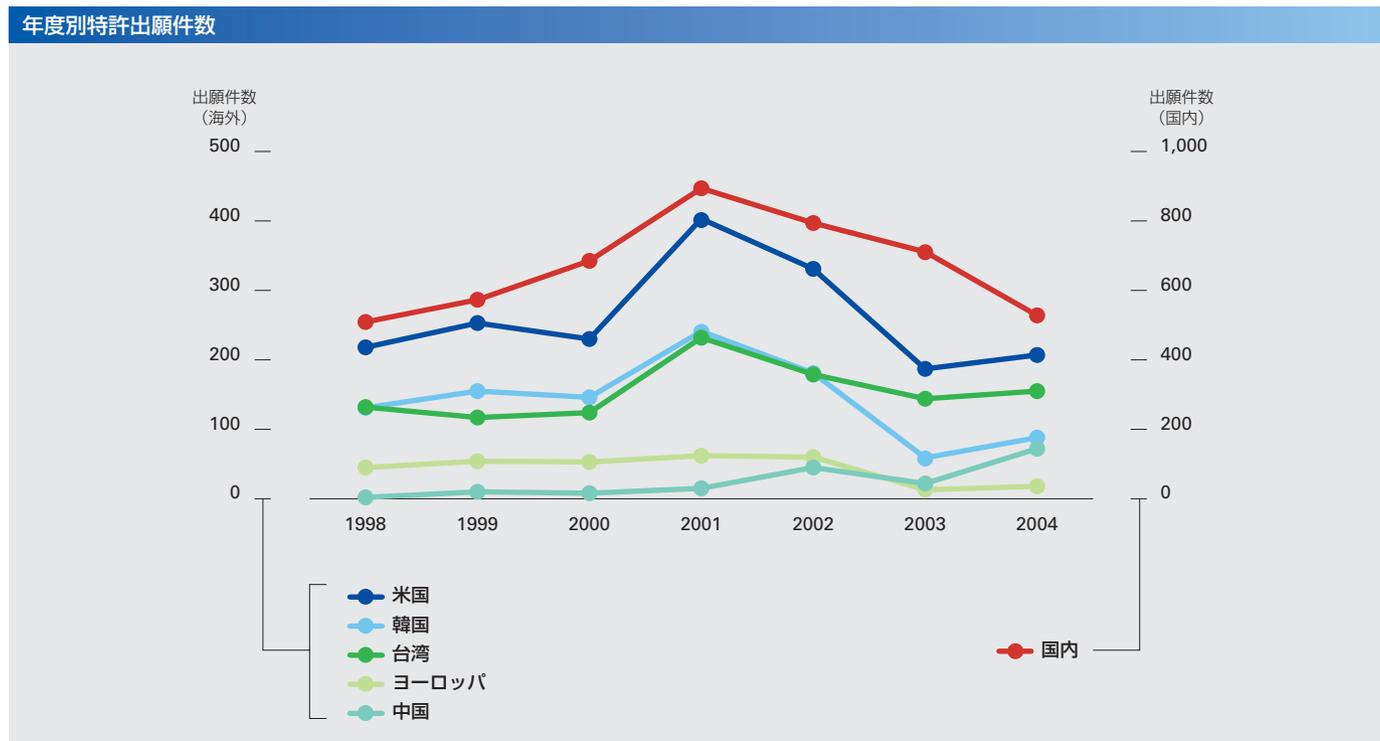
当社においては、「知的財産権に関する規程」にて知的財産権の取り扱いについて定めています。また、当社の知的財産の取得・管理手続きは、経済産業省の定める「知的財産の取得・管理指針」に定める内容とほぼ同レベルの内容となっています。

また、当社においては、「知的財産権に関する規程」に従って、発明・考案・創作者には、特許、実用新案、意匠等の出願・登録時の一時金、社内実施、ライセンス等の社外実施の実績に応じた補償金を支払うとともに、優秀発明賞、最多発明者賞などの発明報奨制度などを制定して、発明・考案・創作に対するインセンティブを与えています。

営業秘密等の管理については、「技術・営業情報管理規程」および「技術・営業情報管理運用マニュアル」に基づいて厳密に管理しており、「営業秘密管理指針」および「技術流出防止指針」にて定められる内容とほぼ同レベルの管理内容となっています。

なお、半導体製造拠点およびFPD製造拠点のグローバル化に伴い、当社では外国における知的財産権の出願につい

ても重視しています。



**主要各国における知的財産権保有件数 (2004年3月31日現在)**

	日本	米国	韓国	台湾	中国	ドイツ	フランス	その他	合計
特許	2,453	1,875	772	969	19	103	57	350	6,598
実用新案	64	0	2	40	6	0	0	0	112
意匠	156	62	99	59	41	27	44	165	653
商標	196	25	37	65	21	16	15	274	649
合計	2,869	1,962	910	1,133	87	146	116	789	8,012

日本の特許庁調査によると、2001年の特許についての審査請求に対する登録率は、当社は73.9%であり、第10位にランクされました。

また、米国の知的財産調査会社であるCHI Research Inc.社の調査によると、当社は米国特許について、1996年から2000年の5年間に、関連技術に関する特許引例として挙げられた頻度の高かった上位5%の特許 (Elite

Patent) の保有率 (自社米国特許件数に占める Elite Patent の割合) のランキングにおいて世界第1位となりました。これは、優れた特許を効率良く出願権利化していることの表れであり、国際的な競争力強化に繋がっていると考えています。